国防科技大学学报

JOURNAL OF NATIONAL UNIVERSITY OF DEFENSE TECHNOLOGY

SiC纤维先驱丝一聚碳硅烷纤维的研制

五〇五材料实验研究室

提要本文对 SiC 纤维的先躯丝——聚碳硅烷纤维的合成进行了研究。 聚碳硅烷是由聚硅烷在聚硼硅氧烷(派松)催化下热解而成。熔融纺丝制得的 聚碳硅烷纤维,经空气不熔化处理后,在 N₂ 气氛下,1250℃烧成具有金属光 泽的 SiC 纤维。通过元素分析,红外光谱分析,热分析及裂解气相色谱分析, 对聚硅烷,聚碳硅烷和聚硼硅氧烷的性质和合成工艺进行了研究。

1. 前 言

随着宇航、导弹、原子能、重型机械、化工及高溫工程等尖端科学技术的发展,迫 切需要高比强、高模量、耐高溫、抗氧化、耐腐蚀的新型结构材料;无机纤維被认为是 最有希望滿足这些特殊要求的材料之一,而从有机硅聚合物转化成的无机纤維——SiC 紆維是受到人们极大关注的一种新型无机新維。

碳化硅的共价性很强,Si-C鏈的离子性仅为14%,Si与C间构成类似金刚石的结构,Si-C鏈的高稳定性,赋予SiC高熔点、高硬度和优良的抗氧化性。但是要从SiC 直接拉制連续新維显然是不可能的。一般欧美国家采用类似制硼新維的CVD法(化学 气相沉积法)制造SiC新維,1975年日本国东北大学矢岛圣使教授及其助手们发明了 从有机硅聚合物——聚碳硅烷首先制成先驱絲,然后经高溫再转化成SiC新維。我们 认为这是一种新型制造无机新維的先进方法。这种方法与CVD法制造SiC 新維的不同 之处主要在于:它不需要用W絲或C絲做芯材,从而使生产工艺大大简化,制出的新維 直径只有10微米左右,强度、模量均较高。

矢岛制造 SiC 新維的工艺流程可简化如下:

本文1984年5月收到



Mark 【、【与 【型的区分主要是在聚硅烷转化成聚碳硅烷这一步。制 Mark 【、】型 是在高压釜中加热加压下进行,而制造 Mark 】时的原 料中 尚加 入少许二 苯基二氯硅 烷; Mark 】型则是在聚硅烷中加入催化剂——派松 (python),从而可在常压下完成转 化。

我们从1980年开始根据矢岛发表的文献资料^[1-8] 按 Mark I 型 工 艺 路 线 制 造出 SiC 新維。

制造Mark Ⅱ型 SiC 新維的工艺关键:

- ① 制造合格的催化剂---派松(python);
- ② 控制聚碳硅烷的分子量与分布,以及分子链的结构;
- ③ 掌握聚碳硅烷纺絲技术及不熔化工艺条件;
- ④ 不熔化絲的高溫烧结工艺。

2. Mark III 型 SiC维纤的制造

Mark I型 SiC 新維的制造过程可大致分为以下几步: (1) 二甲基二氯硅烷在金属钠作用下聚合成聚二甲基硅烷

n(CH₃)₂SiCl₂+2nNa
→
$$\begin{bmatrix} CH_3 \\ I \\ Si \\ I \\ CH_3 \end{bmatrix}$$
 + 2nNaC1

(2) 二苯基二氯硅烷与硼酸反应生成派松



(3) 干燥的聚硅烷与3-4wt% 派松混合在 N₂ 气流中加热,聚硅烷转化成聚碳硅烷 CH₃ $\left\{\begin{array}{c} CH_3\\ I\\ Si\\ I\\ \end{array}\right\}_n \xrightarrow{CH_3} \left\{\begin{array}{c} CH_3\\ I\\ Si\\ I\\ \end{array}\right\}_n \xrightarrow{CH_2} \left\{\begin{array}{c} Si\\ I\\ I\\ \end{array}\right\}_n$

(4) 聚碳硅烷经熔融纺絲制成聚碳硅烷新維。

CH.

(5) 聚碳硅烷新維在空气中氧化得到不熔化絲。

(6) 不熔化絲在 N₂ 气保护下高温灼烧即制成 SiC 新維。

3. 实验结果和讨论

 二甲基二氮硅烷(北京化工二厂产品)与金属钠在 N₂ 气保护下加热 生成 聚二 甲基硅烷,熔点为 350~370℃,不溶于一般溶剂,在空气中加热至 150℃ 即着火燃烧。
 经X ——射线衍射分析证明它是一种晶体,元素分析结果列于表 1.

	Si wt%	C wt%	H wt%	O wt%
CH ₃ 按 { Si } ₁ 计算值 CH ₃	48.29	41.31	10.40	0
实验测定值	47.27	41.63	9.70	0.95
換算成克原子比	1.00	2.04	5.7	0.035

聚二甲基硅烷的元素分析

表 1

元素分析的实验值与理论计算值基本上是吻合的。少量氧的引入主要是由于聚硅烷 端基的水解,另外,金属钠的表面氧化,氮气的不纯等也能引入少量的氧。

聚硅烷的红外光谱分析结果见图 1. 波数为 2950cm⁻¹、2900cm⁻¹、1400cm⁻¹ 者为 C—H鍵吸收峰; 波数为 1250cm⁻¹、835cm⁻¹、750cm⁻¹、690cm⁻¹、635cm⁻¹ 者为 Si—CH₃ 鍵的吸收峰; 波数为 1000~1100cm⁻¹ 者为 Si—O 鍵吸 收峰; 波 数为 3200~3600cm⁻¹ 者为OH吸收峰。 根据元素分析结果和红外光谱分析结果可以认为聚二 甲基 硅烷的 分子 式用下式表示:

$$CH_{3}O \left(\begin{array}{c} CH_{3} \\ si \\ CH_{3}O \left(\begin{array}{c} si \\ c \\ H_{3} \end{array} \right)_{n} O CH_{3}$$

聚二甲基硅烷分子链很规整,是一种结晶度很高的晶体,其熔点与分子链长有如下 关系^[12]:

 $T_m = 378 - 1120/n^{0.61}$

其中: T_m---聚二甲基硅烷的熔点

n——链节数目(即主链硅原子数)

根据熔点为350~370℃,可计算出聚二甲基硅烷的平均分子量在1.5×104~5.5×104范 围。实际从红外光谱图可看出,其中仍含有 Si一O鍵。

2. 由二苯基二氯硅烷与硼酸在正丁醚溶剂中用 N₂ 气保护进行反应,18 小时后, 加水蒸餾,溶剂除尽后将溫度提高到 350℃,保溫 1 小时,即得淡黄色、透明 树脂状物 质,定名为派松(python),其软化点为 60~70℃,元素分析见表 2.



图 1 聚二甲基硅烷的红外光谱图

派	松	的	元	素	分	析

表 2

	Si wt%	C wt%	H wt%	B wt%	O wt%
实验测定值		67.61	4.85	2.98	
文献报导值[6]	16.23	59.10	4.90	3.68	7.80



图 2 是派松的红外光谱曲线,波数为 3600cm⁻¹ 为 ○ H 基吸 收峰,3500~3100cm⁻¹ 为 ○ H 建吸收峰,1600cm⁻¹ 为 C₆H₅ 基的吸收峰,1500~1300cm⁻¹ 为 B - ○ 建吸收峰,1150~1000cm⁻¹ 为 Si - ○ 建吸收峰。

根据以上分析,我们考虑派松的基本结构单元为:

$$HO \left\{ \begin{array}{c} C_{\theta}H_{\theta} \\ \vdots \\ C_{\theta}H_{\theta} \end{array} \right\} = O - B \left\{ \begin{array}{c} O - \\ O \end{array} \right\}_{n}$$

3. 聚硅烷与派松混合在常压下加热至 350~380℃,进行热解重排,将所得产物溶于二甲苯,过滤,除去不溶物,再蒸餾除去溶剂后,将溫度提高到 330℃ 蒸餾,以除去低分子部分,冷却后,卽获得树脂状的聚碳硅烷。

聚碳硅烷的元素分析见表 3.

聚	碳	硅	炨	的	元	★	分	析
~								

表 3

	Si wt%	C wt%	H wt%	O wt%	B wt%
实验测定值	45.25	39,26	8.82		
文献报导值 ^[8]	44.5	35.8	8.00	4.83	几个 ppm

红外光谱谱图见图 3,把它与聚二甲基硅烷的红外光谱谱图(见图 2)相比较,可发

现聚碳硅烷的 红外 光谱 曲 线波数在 2100cm⁻¹处出现一个强的Si---H鍵特 征吸收峰,在1020cm⁻¹和 1350cm⁻¹ 处出现两个Si--CH₂--Si 鍵吸收峰, 而在图 2 聚硅烷的红外光谱曲线中这 些峰是不存在的。

聚硅烷加入3.2wt%的派松在N₂ 保护下的差热分析和热失 重 结 果 见 图 4. 从曲线 可 以看出,聚 硅 烷 在 200℃左右开始分解生成自由基,幷伴 随着热失重。在生成自由基的同时,生 成新的较稳定的化学鍵,幷放出H₂.







所以总的热效应是出现放热峰。此放热峰出现在聚硅烷熔化温度以前,说明聚硅烷在未 熔化之前已经开始出现了热分解,进行重排反应,根据文献报导和我们实验结果,推测 由聚硅烷转化成聚碳硅烷的过程是一个热分解、分子重排和脱氢缩合几个反应同时发生 的过程,其反应可用以下各式表示。

在催化剂一派松(python)存在下





出现了 Si-H 鍵和以 Si-C-Si 鍵为骨架的分子链。

聚碳硅烷分子中存在着大量的 Si-H鏈,对热是十分敏感的。在我们实验室用裂解 色谱仪对聚碳硅烷热解放氢量进行了分析,见图5,说明聚碳硅烷热解脱氢量是随着温 度升高而增多。





从图 5 可以看出,聚碳硅烷大约在80℃时即发生热分解,值得注意的是,聚碳硅烷 热分解放氢量随温度的变化大致可以分为三个区域,即图5中的Ⅰ、Ⅱ和Ⅱ区。而且在 这三个温度区域中,聚碳硅烷热分解放氢量与温度之间呈现一定的线性关系。我们用一 元线性回归方法对三个温度区域中的这种关系进行了数字处理,结果如表4所示。

表 4 表明,聚碳硅烷热分解放氢量与温度的 关 系,在 80-200℃ 和220°-340℃这 两个温度范围内都有较好的线性关系。相关系数分别为0,98 和 0,90; 超过400℃,这种 线性关系就很差了。

区域	溫度范围 (℃)	<u>溫</u> 度 (℃)	放氢量峰高 (毫米)	取值数	放氢量随溫度的变 化率(H峰高/C)	相关系数
I	80~200	80 100 120 140 160 180 200	0.8 1.7 6.7 8.7 9.0 10.8 15.2	7	0.13	0.98
I	220~340	220 240 260 300 320 330 340	29.8 56.0 95.0 122.7 172.9 195.0 217.2 235.0	8	1.74	0.90
I	350 ~ 440	350 360 370 380 400 420 440	262.8 337.4 528.0 786.4 928.0 1068.8 1256.0	7	11.40	0.79

聚碳硅烷热分解放氢量与温度的关系

表 4

根据分析结果可以推测,在【区主要是部分的Si-H鍵断裂脱氢:

$$\begin{array}{c} CH_{3} & CH_{3} \\ -S_{1} & \bigtriangleup & | \\ -S_{1} - CH_{2} - \xrightarrow{\bigtriangleup} - S_{1} - CH_{2} - + H \\ | \\ H \end{array}$$

$$(5)$$



裂解溫度升高(I区),除Si-H鍵的断裂脫氢外,与Si-C主链中C原子上的氢和测基C 原子上的連接的氢也可能由于自由基的夺氢反应而脫去:

$$\begin{array}{ccc} CH_{3} & \cdot CH_{2} \\ \downarrow & \downarrow \\ H \cdot + - CH_{2} - \underbrace{Si-}_{I} & - CH_{2} - \underbrace{Si-}_{I} + H_{2} \uparrow \\ \downarrow & \downarrow \\ H & H \end{array}$$
(7)



$$\begin{array}{cccc} CH_{8} & H-Si-CH_{8} & CH_{8} & H-Si-CH_{8} \\ -CH_{2}-Si-+ & CH & \longrightarrow -CH_{2}-Si & -CH \\ \cdot & & & & & & & & & & & (11) \end{array}$$

 $H-Si-CH_{s}$ $-CH_{2} H-Si-CH_{s} -CH$ $-CH_{2}-Si-+ \cdot CH \longrightarrow CH_{2}$ $H -CH_{2}-Si H -CH_{2}-Si H -CH_{2}-Si-$ H H H H H

当裂介溫度高于 400℃, 脫氢反应加剧, 很快变成交联的不熔不溶的聚碳硅烷, 失去纺絲性能。

从上面裂解色谱分析结果可知,在 350~380℃ 下合成聚碳硅烷时,显然 是有支化 的,这对纺絲是不利的;但是当**溫度过低时**,Si—Si 鍵转化成 Si—C 鍵的 重 排 反应所 需时间很长,而且转化不完全,这对最终 SiC 新維的质量影响很大。紫外光谱分析证 明,我们合成的聚碳硅烷分子中仍含有少量的 [Si—Si]_{2~8} 的链段。 **4. 聚碳硅烷的纺絲——Si**C 新維的先驱絲

经大量实验证明,先驱絲的质 量与聚碳硅烷的纺絲性有直接关 系,而聚碳硅烷分子链结构,分子 量大小及其分布宽窄是影响聚碳硅 烷纺絲性的重要因素。

在上述聚碳硅烷热解重排反应 过程中所以能产生多种不同结构和 各种分子量及其不同分布是与合成 聚碳硅烷的工艺条件有关,综观反 应全局,我们认为重要的工艺条件 是:热解溫度,热解时间与催化剂 ---派松(pytnon)的用量。

从图 5 可看出,重排反应溫度 越高,脫氢缩合越易发生,则分子 量越大,支化交联也容易,致使聚 碳硅烷熔融溫度过高,不易纺絲, 但溫度过低,使产物分子量太小, 也不易成絲。

派松用量增加,不仅会使低分 子量的聚碳硅烷减少,而且会发生 交联或凝胶化,使聚碳硅烷得不到 流动的熔体而不易纺絲。

由于整个反应是个热分解的逐 步反应过程,当然与反应的时间密 切相关。

上述三个工艺参数应有机地组 合起来选择出适于纺絲的聚碳硅烷 的最佳工艺条件。



图 6 纺缘装备简图

关于聚碳硅烷的分子量,实验结果表明,数均分子量在1200-2500之间的均能纺 絲,平均分子量低于1000时,室溫下不易凝固,分子量过高,软化溫度太高,造成纺 絲困难,甚至在纺絲过程中交联,固化在纺絲筒中。

控制分子量分布的方法是用提高蒸餾溫度将低分子物部分除去。

根据我们实验室条件与聚碳硅烷分子量较低的特点,我们采用了熔体纺絲法。

纺絲设备是自行设计、加工的一个金属纺絲筒,上面有 № 气入口处,下面装有分配 板,过滤网和喷絲板,在纺絲筒中装有一定量树脂后,首先用 № 气置换出空气,然后 加热使树脂熔成熔体,用 № 气加压使熔体从喷絲孔中流出,在空气中固化,将絲条纏 绕在一个可调速的滚筒上,以滚筒转速来控制絲的直径,其喷絲孔 直径 一般 为 0.25一 0.30 毫 米,其流程见图 6.

5. 先驱絲的不熔化处理

先驱絲很脆,为了增加先驱絲的强度,使聚碳硅烷新維在高溫烧结过程中不粘结, 必须进行不熔化处理。不熔化处理的溫度是根据差热分析结果选定的。



图 7 聚碳硅烷纤维在空气中的TG-DTA曲线

图 7 是先驱絲在空气中的 T G -- D T A 曲线,由图 7 看出,聚碳硅烷新 維在 144℃ 有一个明显地氧化放热峰,氧化结果,使新維重量增加,据推断,在此溫度下,聚碳硅 烷与氧的反应可示意为



这样,在先驱絲上生成交联、不再熔化的聚合物,使先驱絲 在烧 结过 程中 不能熔化粘结。

根据差热分析结果,把先驱絲在空气中逐漸升溫至140~150℃,即得到不熔化絲。

6. 不熔化絲的高溫热处理---SiC 新維的形成

为了合理制定不熔化絲高溫热处理的程序,我们做了不熔化絲在 N₂ 气氛下的差热 分析和热失重曲线,见图 8,



图 8 不熔化缘的 TG-DTA 曲线 (N₂ 气)

从 TG 曲线可以看出,整个过程是逐漸失重的,直到 800℃ 左右,重量不再变化。 从 DTA 曲线可以看出,不熔化絲 200℃左右开始有分解,在 200~400℃ 左右是一个放 热过程,这是分子间发生交联的结果,前述的(4)至(12)各反应均有发生的可能。500 ~600℃有较大的放热峰,表明分子间发生了进一步的交联,生成含有 一C=C-结构 单元或环状复杂结构,并伴随有甲烷(CH4)气的放出,推测其反应为:

$$-S_{i}-CH_{3} \longrightarrow -S_{i} \cdot + \cdot CH_{3}$$
(13)

$$-S_{i}-CH_{s} + \cdot CH_{s} \longrightarrow -S_{i}-CH_{s} \cdot + CH_{4}^{\uparrow}$$
(14)

$$-S_{i} \cdot + \cdot C_{H_{2}} - S_{i} - \longrightarrow -S_{i} - C_{H_{2}} - S_{i} - (15)$$

$$-S_{i}-CH_{2} \cdot + \cdot CH_{2} - S_{i} - \longrightarrow -S_{i}-CH_{2} - CH_{2} - S_{i} - (16)$$

$$\begin{array}{c|c} & | & | & | \\ -S_{i}-CH_{2}-CH_{2}-S_{i}-S_{i}-S_{i}-CH-CH-S_{i}-H_{2}\uparrow \\ & | & | & | \end{array}$$
(17)

还可能发生分子链间的交联环化反应。



从反应(17)和(18),可以解释游离碳产生的原因。600~800℃之间有一个吸热峰, 这是高度交联的有机硅分解,转变成无机物的阶段。800℃以上又有效热现象,这是β --SiC结晶形成,放出晶格能。

根据TG--DTA曲线,我们将不熔化絲放在高溫炉中,用№2气保护,以100℃/小时升溫速度逐漸升溫至1200℃,保溫半小时,然后自然冷却,即可得到黑色的SiC新維。直径一般在10~12μ左右,强度为150kg/mm²左右。

4. 结论

经大量试验初步找到了合成聚硅烷、派松与聚碳硅烷的最佳工艺条件,并对各种产品性能做了初步分析测定。

采用熔融纺絲可得到連续聚碳硅烷新維,经空气氧化,得到一定强度的不熔化
 絲,然后再以100℃/小时的升溫速度,经1250℃下的烧结,得到黑色有金属光泽的碳
 化硅新維。

3. 聚碳硅烷新維的质量除与纺絲工艺有关外,与聚碳硅烷的可纺性密切相关,而 影响聚碳硅烷可纺性的因素主要是聚碳硅烷的分子链结构与分子量大小及其分布宽窄; 而决定这些因素的是合成聚碳硅烷的溫度、催化剂用量和反应时间等工艺条件。

参考文献

- [1] C. A. Burkhard, J. Am. Chem. Soc. 71, 963 (1949).
- [2] S. Yajima et al., Chem. Lett., 931, (1975).
- [3] S. Yajima et al., J. Am. Ceram Soc., 59, 324. (1976)
- [4] S. Yajima et al., Nature, 261 (5562),683 (1976).
- [5] S. Yajima et al., Chem. Lett., 551 (1976).
- [6] S. Yajima et al., Nature 266 (5602), 521 (1977).
- [7] S. Yajima et al., J. Mater. Soc., 13, 2569 (1978).
- [8] S. Yajima et al., Nature, 273 (5663), 525 (1978).
- [9] S. Yajima et al., J. Mater Soc., 15, 720 (1980).
- [10] S. Yajima Trans JSCM 3 (1/2), 6 (1977).
- [11] S. Yajima 18th AIME Annual meeting (1979).
- [12] J. P. Wosson & T. C. Williams, AD-AO 50337 (1977).

Synthesis of Polycarbosilane as the Precursor of SiC Fiber

Abstract

Polycarlosilane (PC), the precursor of SiC filer, was prepared by heating polydimethysilane in the presence of polyborodiphenylsiloxne (python) as catalyst. The properties of polydimethylsilane, polycarbosilane and polyborodiphenylsiloxane have been investigated by IR spectra, chemical analyses, thermal analyses and pyrolysis gas chromatograph. The suitable reaction conditions were found tentatively. The results showed that the properties of the precursor depended on reaction tempesature, additive amount of polyborodiphenylsiloxane and reaction period of polycarbosilane synthetized,

Silion carbide fiber was made by melt-spinning the polycarbosilane, making the precursor fiber infusible by heating in air to about 200°C and finally heating under nitrogen to 1250°C.